

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
17 février 2005 (17.02.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/013746 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷ :
A43B 17/14, 13/12

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2004/002089

(22) Date de dépôt international : 5 août 2004 (05.08.2004)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
03 09746 5 août 2003 (05.08.2003) FR

(71) Déposant et

(72) Inventeur : RHENTER, Jean-Luc [FR/CH]; Route du
Village, CH- 1195 Bursinel (CH).

(74) Mandataire : PONCET, Jean-François; Cabinet Poncet,
7, chemin de Tillier, B.P 317, F-74008 Annecy Cedex (FR).

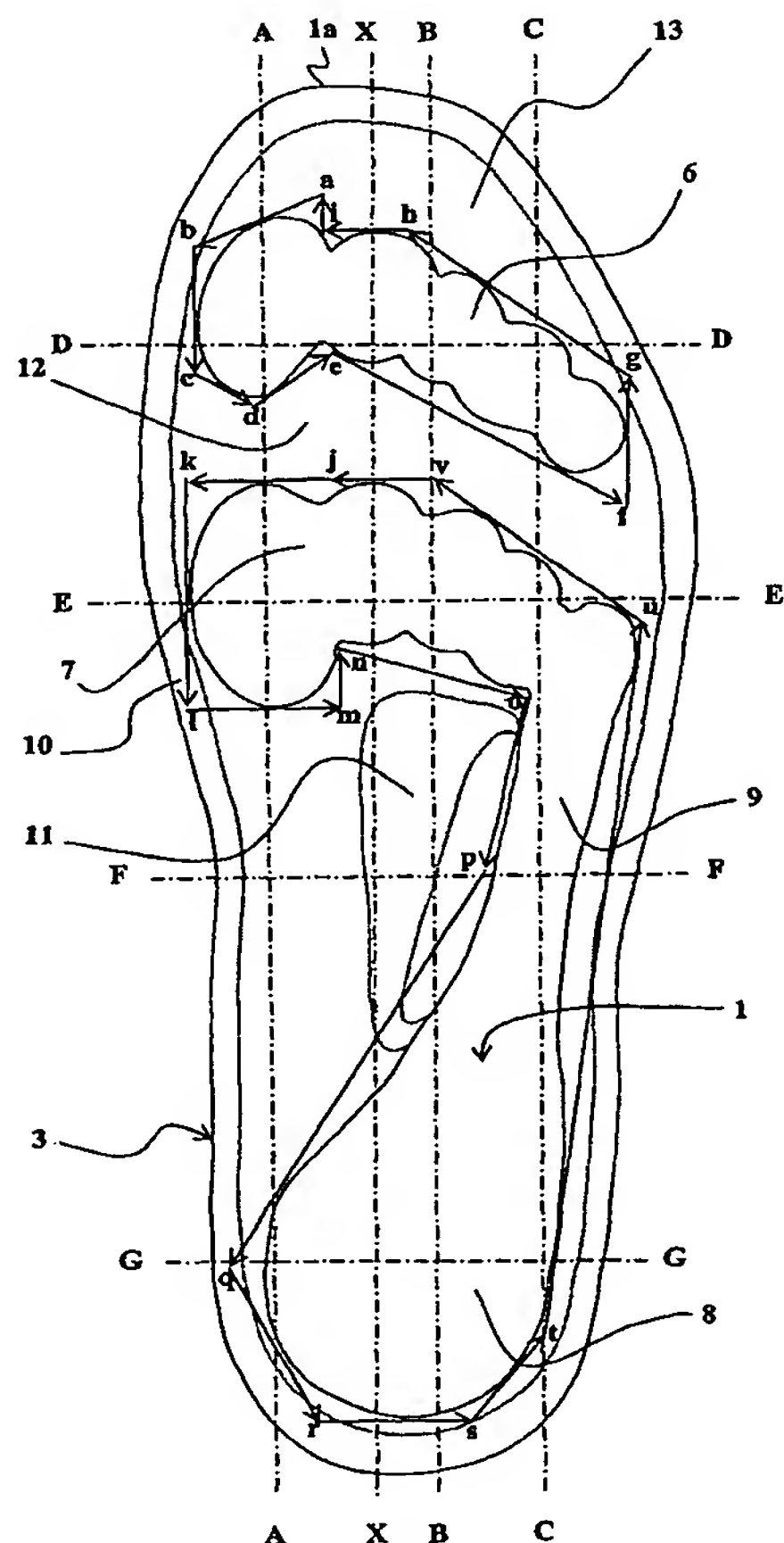
(81) États désignés (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible*) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: SELECTIVELY DAMPING PLANTAR INSOLE

(54) Titre : SEMELLE PLANTAIRE A AMORTISSEMENT SELECTIF



(57) Abstract: The inventive plantar insole is characterised by bearing areas (6, 7, 8, 9) of the main surface which are provided with a rigidity or hardness which are less with respect to other areas (10-13) thereof. Said areas (6-9) are arranged under the major bearing areas of a foot, i.e. under toes, under the metatarsal heads, under the heel and under the external bearing area of the foot, thereby making it possible to attain a compromise between the necessity of an impact absorption and stabilisation of the foot in a shoe, and the insoles may be adapted to any type of footwear.

(57) Abrégé : Une semelle plantaire selon l'invention est caractérisée par des zones d'appui (6, 7, 8, 9) de surface principale qui présentent une raideur ou dureté relative inférieure aux autres zones (10-13), les zones d'appui (6-9) étant placées sous les zones majeures d'appui du pied, à savoir sous les phalanges, sous les têtes de métatarsiens, sous le talon, et sous la zone d'appui externe du pied. On réalise ainsi un compromis entre les nécessités d'amortissement aux chocs et les nécessités de stabilité du pied dans une chaussure, et les semelles s'adaptent à tout type d'article chaussant.

WO 2005/013746 A1



européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

— avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.